DOCKET NO.: 263421US0PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Mami NONOMURA et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP03/08390

INTERNATIONAL FILING DATE: July 2, 2003

FOR: ALLERGEN INACTIVATOR

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119 AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Commissioner for Patents Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

COUNTRY

Japan

APPLICATION NO

DAY/MONTH/YEAR

2002-194588 03 July 2002

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/JP03/08390. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted, OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Customer Number 22850

(703) 413-3000 Fax No. (703) 413-2220 (OSMMN 08/03) Norman F. Oblon Attorney of Record Registration No. 24,618 Surinder Sachar

Registration No. 34,423

PCT/JP03/08390

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

02.07.03

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2002年 7月 3日

REC'D 2 2 AUG 2003

PCT

WIPO

出願番号 Application Number: 特願2002-194588

[ST. 10/C]:

[JP2002-194588]

出 願 人
Applicant(s):

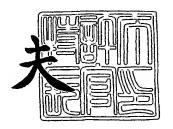
花王株式会社

PRIORITY DOCUMENT

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年 8月 7日





【書類名】

特許願

【整理番号】

P03181407

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

A61K 7/00

【発明者】

【住所又は居所】

栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会社研究所

内

【氏名】

野々村 真美

【発明者】

【住所又は居所】

東京都墨田区文花2-1-3 花王株式会社研究所内

【氏名】

堀 公彦

【発明者】

【住所又は居所】

栃木県芳賀郡市貝町赤羽2606 花王株式会社研究所

内

【氏名】

野尻 浩

【特許出願人】

【識別番号】

000000918

【氏名又は名称】

花王株式会社

【代理人】

【識別番号】

110000084

【氏名又は名称】

特許業務法人アルガ特許事務所

【代表者】

有賀 三幸

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

164232

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要



【書類名】 明細書

【発明の名称】 アレルゲン低減化剤

【特許請求の範囲】

【請求項1】 セルロースエーテル又はスターチエーテルを主鎖とする多糖 誘導体であって、そのヒドロキシ基の水素原子の一部又は全てが、下記一般式(1):

$$-E^{1}-(OA)_{n}-E^{2}-R$$
 (1)

〔式中、 E^1 はヒドロキシ基又はオキソ基が置換していてもよい炭素数 $1\sim6$ のアルキレン基を示し、nは $0\sim5$ 0の数を示し、n個のAは同一又は異なって、炭素数 $1\sim6$ のアルキレン基を示し、 E^2 はエーテル結合又はオキシカルボニル基を示し、Rはヒドロキシ基が置換していてもよい炭素数 $4\sim3$ 0のアルキル基又はヒドロキシ基が置換していてもよい炭素数 $1\sim5$ のスルホアルキル基若しくはその塩を示す。〕

で表される基で置換された多糖誘導体からなるアレルゲン低減化剤。

【請求項2】 アレルゲンが、植物アレルゲン、動物アレルゲン、カビ類、 細菌類及びハウスダストから選ばれる請求項1記載のアレルゲン低減化剤。

【請求項3】 セルロースエーテル又はスターチエーテルが、ヒドロキシエチルセルロースである請求項1又は2記載のアレルゲン低減化剤。

【請求項4】 ダニ又は花粉アレルゲンを無害化するものである請求項1~3のいずれか1項記載のアレルゲン低減化剤。

【請求項5】 ダニ又は花粉アレルゲンをブロックするものである請求項1 ~3のいずれか1項記載のアレルゲン低減化剤。

【発明の詳細な説明】

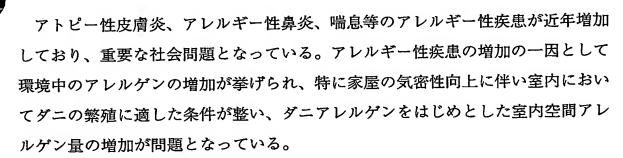
[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、環境中のアレルゲンを低減化するためのアレルゲン低減化剤に関する。

[0002]

【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】



[0003]

アレルギー性疾患の予防及び治療には、斯かるアレルゲンを除去することが合理的な手段であり、これまでにも空気清浄機や高機密性布団カバーにより人とアレルゲンとの接触を妨げる試みがなされてきたが、その効果は充分とは言えないものであった。

また、殺ダニ剤によりダニ数を低減化する試みも行われてきたが、殺ダニ剤自身が人体に悪影響を与えたり、ダニ自体を殺しても残された糞やその死骸にはアレルゲン性が残り、アレルゲン量低減の根本的な解決法とは言えない。

忌避剤によりダニ数を低減化する試みも行われてきたが、効果の持続性に問題があり、ダニ数は時間とともに回復したり、ダニ自体が減少しても残された糞やその死骸にはアレルゲン性が残り、アレルゲン量低減の根本的な解決法とは言えない。

[0004]

更に、茶抽出物等の天然のエキスやタンニン酸等でアレルゲンを化学的に不活性化する試みもなされているが、経時変化による対象物の着色の問題や多量に使用した際の安全性に問題が残されており、商品に用いるのが困難である。

[0005]

本発明は、人体に悪影響が無く、且つ着色等の問題もないアレルゲン低減化剤を提供することを目的とする。

[0006]

【課題を解決するための手段】

本発明者らは、環境中のアレルゲンを安定的に不活化でき、且つ安全性の高い 物質を探索した結果、特定の多糖誘導体が、アレルゲンに対してアレルギー反応 惹起能力を減弱させる作用を有し、アレルゲン低減化剤として有用であることを



見出した。

[0007]

すなわち本発明は、セルロースエーテル又はスターチエーテルを主鎖とする多 糖誘導体であって、そのヒドロキシ基の水素原子の一部又は全てが、下記一般式 (1):

$$-E^{1}$$
- (OA) $_{n}$ - E^{2} - R (1)

〔式中、 E^1 はヒドロキシ基又はオキソ基が置換していてもよい炭素数 $1\sim6$ のアルキレン基を示し、nは $0\sim5$ 0の数を示し、n個のAは同一又は異なって、炭素数 $1\sim6$ のアルキレン基を示し、 E^2 はエーテル結合又はオキシカルボニル基を示し、Rはヒドロキシ基が置換していてもよい炭素数 $4\sim3$ 0のアルキル基又はヒドロキシ基が置換していてもよい炭素数 $1\sim5$ のスルホアルキル基若しくはその塩を示す。〕

で表される基で置換された多糖誘導体からなるアレルゲン低減化剤を提供するものである。

[0008]

【発明の実施の形態】

本発明の多糖誘導体は、水溶性に優れ、高温時に粘度が増大するというレオロジー特性を有すると共に優れた乳化作用をもち、粘稠浴用剤、マッサージ化粧料、シャワー剤、スキンケア剤等、種々のトイレタリー製品の増粘剤及び安定化剤として使用できるものであるが(WOOO/73351号公報)、アレルゲンに対してアレルギー反応惹起能力を減弱させる作用を有することはこれまでに全く知られていない。

[0009]

本発明でいう多糖誘導体は、セルロースエーテル又はスターチエーテルを主鎖とするものであるが、当該セルロースエーテル又はスターチエーテルとしては、セルロース又はスターチにおける水酸基の水素原子の一部をアルキル基及び/又はヒドロキシアルキル基で置換したアルキルエーテルが好ましい。

セルロースエーテルの好適な例としては、メチルセルロース、エチルセルロース、ヒドロキシメチルセルロース、ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシエ



チルメチルセルロース、ヒドロキシエチルエチルセルロース、ヒドロキシメチル ヒドロキシエチルセルロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ヒドロキシプロ ピルメチルセルロース等が挙げられ、特にヒドロキシエチルセルロース、ヒドロ キシプロピルセルロース、メチルセルロース、ヒドロキシプロピルメチルセルロ ース等が好ましい。

[0010]

スターチエーテルの好適な例としては、メチルスターチ、エチルスターチ、ヒ ドロキシエチルスターチ、ヒドロキシメチルヒドロキシエチルスターチ、ヒドロ キシプロピルスターチ等が挙げられ、ヒドロキシエチルスターチ、ヒドロキシプ ロピルスターチが好ましい。

[0011]

上記セルロースエーテル又はスターチエーテルにおいては、ヒドロキシアルキル基のヒドロキシ基に更にアルキル基又はヒドロキシアルキル基が置換して、例えばポリオキシエチレン鎖等を形成することも可能である。

従って、本発明のセルロースエーテル又はスターチエーテルにおけるアルキル 基又はヒドロキシアルキル基の置換度は、構成単糖残基当たり 3.0 を超える置 換度も可能であり、 $0.01\sim3.5$ 、更に $0.1\sim3$ 、更に $1\sim3$ が好ましく 、特に $1.5\sim2$ が好ましい。また、その重量平均分子量は、1万 ~200 万、 5万 ~150 万、特に10万 ~60 万の範囲が好ましい。

[0012]

本発明の多糖誘導体は、上記のセルロースエーテル又はスターチエーテルのヒドロキシ基の水素原子の一部又は全てが、次式(1): $-E^{1}-$ (OA) $_{n}-E^{2}-R$ で表される基で置換されたものであり、その置換度は、構成単糖残基当たり0.0001~1.0、更に0.0005~0.5、更に0.001~0.1の範囲が好ましく、特に0.001~0.05が好ましい。

[0013]

ヒドロキシエチルセルロースを主鎖とする場合の本発明多糖誘導体の部分構造 の一例を示せば以下のとおりである。

[0014]



【化1】

[0015]

式(1)中、 E^1 で示されるヒドロキシ基又はオキソ基が置換していてもよい 炭素数 $1\sim6$ のアルキレン基としては、直鎖又は分岐鎖のいずれでもよく、特に 炭素数2又は3の直鎖のアルキレン基が好ましい。具体的には、例えばエチレン 基、プロピレン基、トリメチレン基、2-ヒドロキシトリメチレン基、1-ヒドロキシメチルエチレン基、1-オキソエチレン基、1-オキソエチレン基、1-オキソトリメチレン基、1-メチル1-メチル1-2ーオキソエチレン基等が好ましく、特に1-2ーオキシメチルエチレン基が好ましく。

[0016]

式(1)中、Aで示される同一又は異なって炭素数1~6のアルキレン基としては、直鎖又は分岐鎖のいずれでもよく、特に炭素数2又は3の直鎖のアルキレン基が好ましい。具体的には、例えばエチレン基、プロピレン基及びトリメチレン基等が好ましく、特にエチレン基が好ましい。

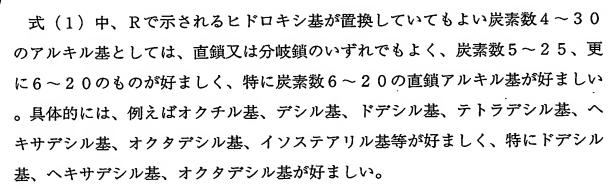
[0017]

nで表される(-OA-)の重合度は、 $0\sim50$ であるが、アレルゲン低減化効果の点から $0\sim40$ 、更に $0\sim30$ 、更に $0\sim20$ 、更に $10\sim20$ が好ましく、特に $10\sim15$ が好ましい。 n個のAは同一でも異なってもよい。ここで n は平均付加モル数の意味である。

[0018]

式 (1) 中、 E^2 はエーテル結合又はオキシカルボニル基(-OCO-又は-COO-)であるが、エーテル結合が好ましい。

[0019]



[0020]

Rで示されるヒドロキシ基が置換していてもよい炭素数1~5のスルホアルキル基としては、例えば2-スルホエチル基、3-スルホプロピル基、3-スルホ-2-ヒドロキシプロピル基、2-スルホー1-(ヒドロキシメチル)エチル基等が挙げられ、中でも3-スルホー2-ヒドロキシプロピル基、2-スルホエチル基が好ましい。

当該スルホアルキル基は、その全てあるいは一部がNa、K、Ca、Mg等の 1族又は2族元素、アミン類、アンモニウム等の有機カチオン等との塩となって いてもよい。

また、スルホアルキル基の置換度は、構成単糖残基当たり $0 \sim 1$. 0、更に $0 \sim 0$. 8、特に $0 \sim 0$. 5 の範囲が好ましい。

[0021]

本発明の多糖誘導体は、WO00/73351号公報記載の方法に準じて製造 すればよく、例えばセルロースエーテル又はスターチエーテルを、下記一般式(2)

$$E^{3}-(OA)_{p}-E^{2}-R$$
 (2)

〔式中、 E^3 は炭素数 $3\sim 6$ のエポキシ化アルキル基、ヒドロキシ基が置換していてもよい炭素数 $1\sim 6$ のハロゲン化アルキル基、又はカルボキシ基若しくは炭素数 $2\sim 6$ のカルボキシアルキル基若しくはそれらの誘導体を示し、n、A、E 2及びR は前記と同じ意味を示す。〕

で表されるポリオキシアルキレン化剤と反応させ、所望により更にスルホン化剤 (ビニルスルホン酸、ヒドロキシ基が置換していてもよい炭素数1~5のハロア ルカンスルホン酸、炭素数2~6のエポキシ基を有するスルホン酸及びそれらの



塩)と反応させることにより製造できる。

[0022]

斯かる多糖誘導体は、後記実施例に示すように、ダニアレルゲンに対してその 抗原性を減弱又は消失させる作用を有する。従って、本発明の多糖誘導体は、各 種アレルゲンに対してアレルギー反応惹起能力を減弱又は消失させ、アレルゲン 低減化剤として有用である。

[0023]

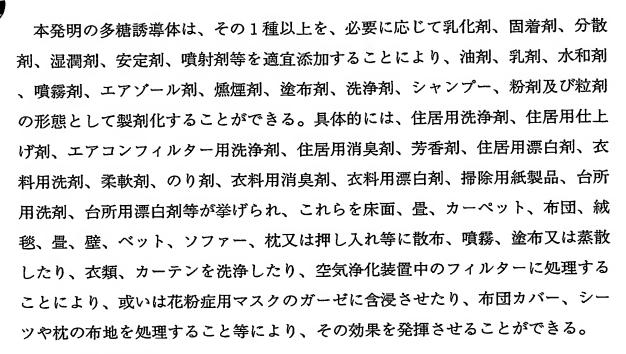
ここで、アレルゲンとは、人及び動物が接触することにより喘息、アレルギー性鼻炎、花粉症、アトピー性皮膚炎等のアレルギー反応を惹起するものを意味するが、本発明においては、例えばスギ、ヒノキ、ブタクサ、カモガヤ等の植物の花粉由来の植物アレルゲン、イヌ、ネコ等の動物の表皮や毛、寄生虫、ゴキブリ、蛾等の昆虫、ヒョウダニ類、コナダニ類、ササラダニ類等のダニ類等の動物由来の動物アレルゲンの他、カビ類や細菌類、ハウスダスト(砂塵、繊維状粒子、ダニの糞等の室内塵)等を特に例示することができる。

[0024]

また、アレルゲン低減化とは、アレルゲン自体が持つアレルギー反応の惹起能力を低減又は無害化することをいい、動物性アレルゲンについては特に忌避剤とは明確に異なる。具体的には、例えばELISAによるアレルゲン測定法で、ダニエキス(ダニ抽出タンパク質)に対して10倍(重量比)の剤で処理した条件下で、蒸留水処理をコントロールとするDerf1(ダニ由来のアレルゲンタンパク質)量(コントロール比)が0.8以下、より好ましくは0.7以下、さらに好ましくは0.6以下である場合に、アレルゲン低減化効果を有するとすることができる。尚、アレルゲンを「包み込む」、「ブロックする」、「活性を抑える」、「非アレルゲン化する」の表現は、本発明のアレルゲン低減化と同義である。

本発明の多糖誘導体によるアレルゲン低減化効果は、ダニアレルゲン、ハウス ダスト、スギ花粉アレルゲン、ネコなどのペットアレルゲンに対して特に有効で ある。

[0025]



[0026]

上記の製剤には、本発明の多糖誘導体に加えて、ダニ、蛾、ゴキブリ等の虫体に対する忌避剤、殺虫剤等を配合するとより効果的であり、斯かる薬剤としては、ダニ、蛾、ゴキブリ等に対する殺虫剤、忌避剤、共力剤、殺菌剤、防黴剤、活性剤、消臭剤及び芳香剤等が挙げられる。

[0027]

例えば、殺ダニ剤としては、dーフェノトリン (3ーフェノキシベンジル dーシス/トランスークリサンテマート)、ペルメトリン (3ーフェノキシベンジル d1ーシス/トランスー2,2ージメチルー3ー(2,2'ージクロロビニル)ーシクロプロパンカルボキシレート)、レスメトリン ((5ーベンジルー3ーフリル)メチル d1ーシス/トランスークリサンテマート)、アレスリン (d1ー3ーアリルー2ーメチルー4ーオキソー2ーシクロペンテニル d1ーシス/トランスークリサンテマート)、フタルスリン ((Nー3,4,5,6,-テトラヒドローフタルイミド)メチル d1ーシス/トランスークリサンテマート)、エムペントリン (1ーエチニルー2ーメチルー2ーペンテニル d1ーシス/トランスークリサンテマート)、d,dT80ープラレトリン (dー2ーメチルー4ーオキソー3ープロパルギルシクロペントー2ーエニル dーシス/トランスークリサンテマート)等の合成ピレスロイドやその誘導体が、また、ヒ



ノキチオール、ベンジルベンゾエイト、ジャスモン酸誘導体などの天然精油成分 由来の抗ダニ物質が挙げられる。

[0028]

ダニ忌避剤としては、例えばジエチルアシド、ジメチルフタレート、ジプチルフタレート、MGKリペレント 326、ダプトレックス、2ーエチル1,3-ヘキサンジオール等が使用できる。

[0029]

[0030]

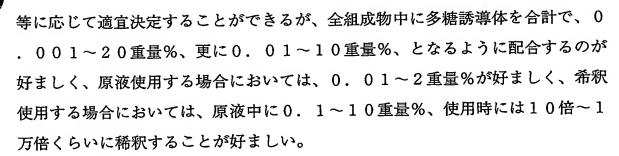
屋内塵性ダニ類の餌となり、それ自体の抗原性もありえるカビ或いは細菌の増殖を抑制する殺菌剤、防黴剤としては、チアベンダゾール、トリクロサン、クロルキシジン、ジンクピリチオン、クロルキシレノール、デンシル、塩化ベンザルコニウム、ジクロフルアニド、安息香酸ナトリウム、pーオキシ安息香酸メチル、フェノキシエタノール、エタノールおよび、キトサン、カテキン、チモール、ヒノキチオール、孟宗竹エキス、カラシ精油、ワサビ精油等の天然由来成分が挙げられる。

[0031]

上記製剤には、本発明の多糖誘導体と既知の抗アレルゲン物質として知られる、タンニン酸や、茶抽出物、ハイドロキシアパタイト、エピカテキン、エピガロカテキンガレート、エピガロカテキンガレート、没食子酸(特開平6-279273号公報)やアレルゲン補足物質であるスメクタイト等の粘土鉱物、アレルゲン除去剤として知られるヒドロキシ安息香酸化合物(特開平11-292714号公報)等とを組み合せて配合することができる。

[0032]

上記製剤中の本発明多糖誘導体の配合量は、その剤型、処理方法及び処理場所



[0033]

【実施例】

以下、実施例を挙げて本発明を更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定 されるものではない。

[0034]

製造例1

重量平均分子量150万、ヒドロキシエチル基の置換度1.8のヒドロキシエチルセルロース(HEC-QP100MH, ユニオンカーバイド社製)80g、80%イソプロピルアルコール640g及び48%水酸化ナトリウム水溶液5.34gを混合してスラリー液を調製し、窒素雰囲気下室温で30分間攪拌した。この溶液に次式:

[0035]

【化2】

$$O_{12}$$
 $C_{12}H_{25}$

[0036]

で表されるポリオキシアルキレン化剤 12.78gを加え、80で8時間反応させてポリオキシアルキレン化を行った。反応終了後、反応液を酢酸で中和し、反応生成物をろ別した。反応生成物をイソプロピルアルコール 500gで2回、減圧下60で1昼夜乾燥し、ポリオキシアルキレン化されたヒドロキシエチルセルロース誘導体(化合物 1)72.0gを得た。

得られたヒドロキシエチルセルロース誘導体のポリオキシアルキレン基を含む 置換基の置換度は 0.0 4 であった。



[0037]

製造例2

製造例1及びWO00/73351号公報記載の方法に準じ、表1に示す化合物2~16を得た。

[0038]

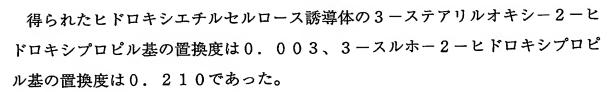
製造例3

(1) 攪拌機、温度計及び冷却管を備えた1000mLのガラス製セパラブル反応容器に、重量平均分子量約150万、ヒドロキシエチル基の置換度1.8のヒドロキシエチルセルロース(HEC-QP100M、ユニオンカーバイド社製)80g、80%イソプロピルアルコール640g及び48%水酸化ナトリウム水溶液5.5gを加えてスラリー液を調製し、窒素雰囲気下室温で30分間攪拌した。これにステアリルグリシジルエーテル2.52gを加え、80℃で8時間反応させて疎水化を行った。疎水化反応終了後、反応液を酢酸で中和し、反応生成物を5別した。反応生成物を50℃のイソプロピルアルコール500gで2回、次いでアセトン500gで2回洗浄し、減圧下70℃で1昼夜乾燥し、疎水化されたヒドロキシエチルセルロース誘導体72.8gを得た。

[0039]

(2) 攪拌機、温度計及び冷却管を備えた500mのガラス製セパラブル反応容器に、(1)で得られた疎水化ヒドロキシエチルセルロース誘導体20.0g、70%イソプロピルアルコール200g及び48%水酸化ナトリウム水溶液1.37gを仕込んでスラリー液を調製し、窒素気流下室温で30分間攪拌した。反応液に3-クロロ-2-ヒドロキシプロパンスルホン酸ナトリウム28g及び48%水酸化ナトリウム水溶液11.9gを加え、50℃で3時間スルホン化を行った。反応終了後、反応液を塩酸で中和し生成物をろ別した。生成物を70%イソプロピルアルコール340gで1回、次いでイソプロピルアルコール120gで2回洗浄後、減圧下70℃で1昼夜乾燥し、3-ステアリルオキシー2-ヒドロキシプロピル基と3-スルホー2-ヒドロキシプロピル基で置換されたヒドロキシプロピル基と3-スルホー2-ヒドロキシプロピル基で置換されたヒドロキシエチルセルロース誘導体(化合物17)18.3gを得た。

[0040]



[0041]

製造例 4

製造例3の方法に準じて表1に示す化合物18を得た。

[0042]

製造例 5

重量平均分子量約80万、ヒドロキシエチル基の置換度1.8のヒドロキシエチルセルロース(HEC-QP15000H、ユニオンカーバイド社製)80g、イソプロピルアルコール640g及びpートルエンスルホン酸2.0gを混合してスラリー液を調製し、窒素雰囲気下室温で30分間攪拌した。この溶液に次式

[0043]

【化3】

[0044]

得られたヒドロキシエチルセルロース誘導体のポリオキシアルキレン基を含む 置換基の置換度は 0.010 であった。

[0045]

製造例 6

(1) ばれいしょでんぷん(片山化学社製)80g、50%イソプロピルアルコール640g及び48%水酸化ナトリウム水溶液5.5gを混合してスラリー液



を調製し、窒素雰囲気下室温で30分間攪拌した。この溶液に次式

[0046]

【化4】

$$O \longrightarrow O \longrightarrow C_{12}H_{25}$$

[0047]

で表される化合物 19.0gを加え、80℃で8時間反応させてポリオキシアルキレン化を行った。反応終了後、反応液を酢酸で中和し、反応生成物を5別した。反応生成物を50%のイソプロピルアルコール500gで2回、次いでアセトン500gで2回洗浄し、減圧下70℃で1昼夜乾燥し、ポリオキシアルキレン化されたでんぷん誘導体69.4gを得た。

得られたでんぷん誘導体のポリオキシアルキレン量を含む置換基の置換度は 0 . 0 0 5 であった。

(2) (1)で得られたポリオキシアルキレン化でんぷん35.5g、70%イソプロピルアルコール350g及び48%水酸化ナトリウム水溶液2.4gを混合してスラリー液を調製し、窒素雰囲気下室温で30分間攪拌した。反応液にモノクロロ酢酸ナトリウム25.1g及び48%水酸化ナトリウム水溶液18.0gを加え、50℃で5時間カルボキシメチル化を行った。反応終了後、反応液を酢酸で中和し生成物をろ別した。生成物を70%イソプロピルアルコール400gで3回、イソプロピルアルコール300gで2回洗浄後、減圧下70℃で1昼夜乾燥し、ポリオキシアルキレン化及びカルボキシメチル化されたでんぷん誘導体(化合物20)33.8gを得た。得られたでんぷん誘導体のカルボキシメチル化度は0.48であった。

[0048]



【表1】

### 150万 150万 1.8 2-E FD = 5-D / 3-D / 3-D 1.8 2-E FD = 5-D / 3-D / 3-D 1.8 2-E FD = 5-D / 3-D / 3-D 2.5 2-E FD = 5-D / 3-D / 3-D / 3-D 2.5 2-E FD = 5-D / 3-D / 3	-	24] [主 強 主 (イルロースエーテルキがはスターチエーテル)	トエーテル		[-E1-	置換基 - (OA)。	## 日 2	; E ² -R-]		
RPS-11 E F ID # E J I		4中中	り、一つ、このにはない。	平均	1	_		-	五2	ਲ	置換度
BPS-43 EFD = シェテルセルロース(UCC) 50万 1.8 2-EFD = シャリメテレン 1.7 トン 1.0 - mC ₀ H ₁ BPS-43 EFD = シェテル・エンチルン(UC) = 0.0 5.0 2-EFD = シャリメテレン エデレン 12 - 0 - mC ₀ H ₁ BPS-43 EFD = シェテル・エンチルン(UC) = 2.5 2-EFD = シャリメチレン エデレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ BPS-63 EFD = シェテル・エンス 10.0 3.5 2-EFD = シャリメチレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ EPS-63 EFD = シェテル・エンス 10.0 3.0 2-EFD = シャリメチレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ EPS-63 EFD = シェテル・エンチル・エンス 10.0 3.0 3-EFD = シャリメチレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ EPS-73 EFD = シェテル・エンチル・エンス 10.0 1.8 3-EFD = シャリメチレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ BPS-73 EFD = シェテル・エンチル・エンス 10.0 1.8 3-EFD = シャリメチレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ BPS-74 EFD = シェテル・リメチレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ 1.8 3-EFD = シャリメチレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ BPS-46 EFD = シェテル・リメチレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ 1.8 3-EFD = シャリメチレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ BPS-47 EFD = シェテア・アル・レルース (MCC) - 10 - 0 - mC ₀ H ₂ 1.8 3-EFD = シャリメチレン 12 - 0 - mC ₀ H ₂ BPS-46 EFD = シェテア・アリメチレン 12 - 0 - 0 - mC ₀ H ₂ 1.8 3-EFD = シャリメチレン 12 - 0 - 0 - mC ₀ H ₂ BPS-46	+=	3PS-11	トドロキシエチルセルロース (UCC)	150万	I.8	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	12	þ	-nC ₁₂ H ₂₅	0.004
BPS-49 ヒドロキシエチルとルロース(ハーキュレズ) 50万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₁ BPS-47 ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレズ) 20万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₁ BPS-48 ヒドロキシブロビルでんぶん(日瀬(牛) 不明 不明 不明 不明 不明 不明 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₁ BPS-33 メチルセルロース(間位) 80万 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₁ BPS-31 ヒドロキシエチルセルロース(加CO 80万 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 18 0- nG ₁ H ₁ BPS-41 ヒドロキシエチルセルロース(MCO) 80万 1.8 2-ヒドロキシエチレン 12 0- nG ₁ H ₁ BPS-42 ヒドロキシエチルセルロース(MCO) 80万 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 18 0- nG ₁ H ₁ BPS-43 ヒドロキシエチルセルロース(MCO) 80万 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 18 0- nG ₁ H ₁ BPS-44	F	3PS-21	ヒドロキシエチルセルロース (UCC)	50万	1.8	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	2	수	-nC ₁₂ H ₂₅	0.004
BPS-47 E ドロキシエチルセルロース(ハーキュレス) 20万 2.5 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₁ BPS-48 E ドロキシエチルセルロース(ハーキュレス) 10万 2.5 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₂ BPS-28 E ドロキシブロピルでんぶん(日級化学) 不明 7-E ドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₂ BPS-38 メチルセルロース(個位化学) 100万 ロキシブロ 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₂ BPS-31 E ドロキシエチルセルロース(個C) 150万 1.8 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₂ BPS-41 E ドロキシエチルセルロース(MC) 150万 1.8 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₂ BPS-42 E ドロキシエチルセルロース(MC) 50万 1.8 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 12 0- nG ₁ H ₂ BPS-43 E ドロキシエチルセルロース(MC) 50万 1.8 2-E ドロキシトリメチレン エテレン 12 0- nG ₁ H ₂ BPS-45 E ドロキシエチルセルロース(MC) 50万 1.8 2-E ドロキシトリメチレン エテレン 12 0- nG ₁ H ₂ BPS-46 E ドロキシエチルセルロース(MC) 50万 2.5 2-E ドロキシトリメチレン エテレン 12 0- nG ₁ H ₂ BPS-41 E ドロキシエチルセルローンス(MC) 180万 1.8 2-E ドロキシトリメチレン 12	۳	3PS-49	ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレス)	50万	2.5	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	12	수	-nC ₁₂ H ₂₅	0.004
EPS-63 ヒドロキシエチルセルロース (ハーキュレス) 10万 2.5 2-ドロキシトリメチレン エテレン 12 ローロのはまました。 EPS-28 ヒドロキシブロビルでんぶん (日酸化学) 不明 不明 不明 2-ドロキシトリメチレン エテレン 12 ローロのにより EPS-28 ヒドロキシブラロビルでんぶん (日酸化学) 100万 ロキシブロビルのより、メテレン 15 ローロのにより ローロのにより EPS-31 ヒドロキシエチルセルロース (旧C) 80万 1.8 2-ドロキシトリメチレン エテレン 12 ローロのにより EPS-42 ヒドロキシエチルセルロース (旧C) 80万 1.8 2-ドロキシトリメチレン エテレン 12 ローロのにより EPS-42 ヒドロキシエチルセルロース (旧C) 50万 1.8 2-ドロキシトリメチレン エテレン 12 ローロのにより EPS-42 ヒドロキシエチルセルロース (旧C) 50万 1.8 2-ドロキシトリメチレン エテレン 13 ローロのより EPS-43 ヒドロキシエチルセルロース (UC) 50万 1.8 2-ドロキシトリメチレン エテレン 13 ローロのより EPS-43 ヒドロキシエチルセルロース (UC) 50万 1.8 2-ドロキシトリメチレン エテレン 13 ローロのより EPS-43 ヒドロキシエチルセルローンエチン	╀	3PS-47	ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレス)	20万	2.5	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	12	÷	-nC12H25	0.014
EPS-38 ヒドロキシブロビルでんぶん(日酸化学) 不明 不明 2-ドロキシトリメチレン エテレン 12 0 nCnHs	F	3PS-63		10万	2.5	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	2	÷	-nC ₁₁ H ₂₅	0.02
Pro	尸	EPS-28	ヒドロキンプロピルでんぷん(日酸化学)	不明	不明	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	12	÷	-nC ₁₁ H ₂₅	0.002
BPS-33 メチルセルロース(債越化学) 100万 ne1.4 E k 2- k ロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₁₅ BPS-31 E k ロキシエチルセルロース (UCC) 150万 1.8 2- k ドロキシトリメチレン エチレン 9 -0- -nC ₁ H ₁₅ BPS-31 E k ロキシエチルセルロース (UCC) 80万 1.8 2- k ドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₁₅ BPS-35 E k ロキシエチルセルロース (UCC) 150万 1.8 2- k ドロキシトリメチレン エチレン 13 -0- -nC ₁ H ₁₅ BPS-42 E k ロキシエチルセルロース (UCC) 50万 1.8 2- k ドロキシトリメチレン エチレン 13 -0- -nC ₁ H ₁₅ BPS-43 E k ロキシエチルセルロース (UCC) 50万 1.8 2- k F ロキシトリメチレン エテレン 12 -0- -nC ₁ H ₁₅ BPS-43 E k ロキシエチルモルロース (UCC) 50万 1.8 2- k F ロキシトリメチレン エテレン 12 -0- -nC ₁ H ₁₅ BPS-45 E k ロキシエチルモルローンエチルモルロース (ハーキュレス) 1.05 2.5 2- k F ロキシトリメチレン 12 -0- -nC ₁ H ₁₅ BPS-46 E k ロキシエチルモル	╁	1	ヒドロキシエチルセルロース (UCC)	80万	8.	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	2	÷	-nC ₁₈ H ₃₇	0.003
IPS-II EFGT=シエチルセルロース(UCC) 150万 1.8 2-EFGT=シトリメチレン エチレン 12 9 -0 -nC ₁₃ H ₃ IPS-31 EFGT=シエチルセルロース(UCC) 80万 1.8 2-EFGT=シトリメチレン エチレン 12 -0 -nC ₁₃ H ₃ IPS-35 EFGT=シエチルセルロース(UCC) 150万 1.8 2-EFGT=シトリメチレン エチレン 12 -0 -nC ₁₃ H ₃ IPS-47 EFGT=シエチルセルロース(NCC) 50万 1.8 2-EFGT=シトリメチレン エチレン 12 -0 -nC ₁₃ H ₃ IPS-47 EFGT=シエチルセルロース(NCC) 50万 2.5 2-EFGT=シトリメチレン エチレン 12 -0 -nC ₁₃ H ₃ IPS-47 EFGT=シエチルセルロース(NCC) 150万 2.5 2-EFGT=シトリメチレン エチレン 12 -0 -nC ₁₃ H ₃ SPS-47 EFGT=シエチルセルロース(NCC) 150万 2.5 2-EFGT=シトリメチレン 12 -0 -nC ₁₃ H ₃ SPS-47 EFGT=シエチルセルロース(NCC) 150万 2.5 2-EFGT=シトリメチレン 12 -0 -0 -nC ₁₃ H ₃ SPS-47 EFGT=シエチレルコ・エチレン 12 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 -0 <t< td=""><td>+</td><td>EPS-33</td><td>メチルセルロース (信越化学)</td><td>100万</td><td>Mel.4とド ロキシブロ ピル0.2</td><td>2-ヒドロキシトリメチレン</td><td>エチレン</td><td>21</td><td>þ</td><td>-nC₁₂H₂₅</td><td>0.004</td></t<>	+	EPS-33	メチルセルロース (信越化学)	100万	Mel.4とド ロキシブロ ピル0.2	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	21	þ	-nC ₁₂ H ₂₅	0.004
EPS-31 ヒドロキシエチルセルロース(WCC) 80万 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 10 -nC ₁ H ₃ EPS-35 ヒドロキシエチルセルロース(WCC) 150万 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 10 -nC ₁ H ₃ EPS-42 ヒドロキシエチルセルロース(WCC) 50万 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0 -nC ₁ H ₃ EPS-43 ヒドロキシエチルセルロース(WCC) 50万 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0 -nC ₁ H ₃ EPS-44 ヒドロキシエチルセルロース(WCC) 20万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0 -nC ₁ H ₃ EPS-45 ヒドロキシエチルセルロース(WCC) 150万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0 -nC ₁ H ₃ SPS-46 ヒドロキシエチルセルロース(WCC) 150万 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0 -nC ₁ H ₃ SPS-47 ヒドロキシエチルセルロース(WCC) 80万 1.8 -C(H ₂ J ₃ CO -0 -0 -nC ₁ H ₃ - はわいしょでんぷん (片山化学) - - -とドロキシトリメチレン エチレン 50 -0 -0 -nC ₁ H ₃ - - - - - - -	干	EPS-1	トドロキシエチルセルロース (UCC)	150万	1.8	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	6	þ	-nC ₁₁ H ₂₅	0.0055
EPS-45 ヒドロキシエチルセルロース (UCC) 150万 1.8 ?-ヒドロキシトリメチレン エチレン 19 -0- -nC ₁ H ₃ EPS-47 ヒドロキシエチルセルロース (VCC) 50万 1.8 ?-ヒドロキシトリメチレン エチレン 15 -0- -nC ₁ H ₃ EPS-47 ヒドロキシエチルセルロース (VCC) 50万 1.8 ?-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₃ EPS-47 ヒドロキシエチルセルロース (VCC) 20万 2.5 ?-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₃ EPS-46 ヒドロキシエチルセルロース (VCC) 150万 2.5 ?-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₃ SPS-41 ヒドロキシエチルセルロース (WCC) 150万 2.5 ?-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₃ SPS-48 ヒドロキシエチルセルロース (WCC) 80万 1.8 -(CH ₂) 3(O- エチレン 10 -0- -nC ₁ H ₃	F	EPS-31		80万	1.8	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	12	ا	-nC ₁₂ H ₂₅	0.0041
EPS-47 とドロキシエチルセルロース(ハーキュレス) 10万 2.5 2-ドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₃ EPS-44 とドロキシエチルセルロース(UCC) 50万 1.8 2-とドロキシトリメチレン エチレン 15 -0- -nC ₁ H ₃ EPS-41 とドロキシエチルセルロース(ハーキュレス) 20万 2.5 2-とドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₃ EPS-46 とドロキシエチルセルロース(ハーキュレス) 20万 2.5 2-とドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₃ SPS-KI とドロキシエチルセルロース(UCC) 80万 1.8 2-とドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₃ - ほれいしょでんぷん (片山化学) - - - -とドロキシトリメチレン エチレン 50 -0- -nC ₁ H ₃ - <	干	EPS-35		150万	l.8	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	13	÷	-nC ₁₂ H ₂₆	0.004
EPS-44 E ドロキシエチルセルロース (DCC) 50万 1.8 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 15 -0- -nC ₁ H ₁ s EPS-62 E ドロキシエチルセルロース (ハーキュレス) 10万 2.5 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₁ s EPS-41 E ドロキシエチルセルロース (ハーキュレス) 20万 2.5 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₁ s EPS-46 E ドロキシエチルセルロース (ハーキュレス) 150万 2.5 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₁ s SPS-81 E ドロキシエチルセルロース (UCC) 80万 1.8 2-E ドロキシトリメチレン エチレン 10 -0- -nC ₁ H ₁ s - E ドロキシエチルセルロース (UCC) 80万 1.8 -(CH ₁) ₃ CO- エチレン 50 -0- -nC ₁ H ₁ s - E ドロキシエチルセルロース (UCC) 80万 1.8 -(CH ₁) ₃ CO- エチレン 50 -0- -nC ₁ H ₁ s - E ドロキシエチルセルロース (MCC) 80万 - - -E ドロキシトリメチレン エチレン 0 -0- -nC ₁ H ₁ s - E ドロキシエチルセルロース (F	EPS-42		10万	2.5	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	12	수	-nC ₁₁ H ₂₅	0.004
EPS-62 ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレス) 10万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁₀ H ₃ s EPS-41 ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレス) 20万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁₀ H ₃ s EPS-46 ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレス) 150万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁₀ H ₃ s SPS-K1 ヒドロキシエチルセルロース(UCC) 150万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン - 0 -0- -nC ₁₀ H ₃ s - ヒドロキシエチルセルロース(UCC) 80万 1.8 -(CH ₂) ₂ CO- エチレン 50 -0- -nC ₁₀ H ₃ s - はれいしょでんぶん(片山化学) - - - 2-ヒドロキシエチレン エチレン 50 - -nC ₁₀ H ₃ s SURP67 ヒドロキシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 PUUS ヒドロキシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 BUSOS ヒドロキシエチルセルロース - - - -	干	EPS-44	トドロキシエチルセルロース (UCC)	50万	1.8	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	12	수	-nC ₁₆ H ₃₃	不現
EPS-41 ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレス) 20万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁₁ H ₃ s SPS-46 ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレス) 20万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン エテレン 12 -0- -nC ₁₁ H ₃ s SPS-K1 ヒドロキシエチルセルロース(UCC) 150万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン - 0 -0- -nC ₁₁ H ₃ s - ヒドロキシエチルセルロース(UCC) 80万 1.8 -(CH ₃) 3CO- エチレン 50 -0- -nC ₁₁ H ₃ s - ほれいしょでんぶん(片山化学) - - - 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 50 -0- -nC ₁₁ H ₃ s SURFOT ヒドロキシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 PUUS ヒドロキシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	干	EPS-62	ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレス)	10万	2.5	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	12	÷	-nC ₁₂ H ₂₅	0.0123
EPS-46 ヒドロキシエチルセルロース(いC) 2.0万 2.5 2-ヒドロキシトリメチレン エチレン 12 -0- -nC ₁ H ₃ SPS-K1 ヒドロキシエチルセルロース(いC) 150万 1.8 2-ヒドロキシトリメチレン - 0 -0- -nC ₁ H ₃ - ヒドロキシエチルセルロース(いC) 80万 1.8 -(CH ₂) 3CO- エチレン 50 -0- -nC ₁ H ₃ - 様れいしょでんぶん (片山化学) - - 2-ヒドロキシエチレン メチレン 10 -0- -nC ₁ H ₃ SURF67 ヒドロキシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 PLUS ヒドロキシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	尸	EPS-41	ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレス)	20万	2.5	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	2	수	-nC ₁₁ H ₂₅	0.004
SPS-K1 E ドロキシエチルセルロース(UCC) 150万 1.8 2-Eドロキシトリメチレン - 0 -0 - InC _{IB} H _J - E ドロキシエチルセルロース(UCC) 80万 1.8 -(CH _J) ₃ CO- エチレン 50 -0 - InC _{IB} H _J - 様れいしょでんぶん (片山化学) - - 2-Eドロキシトリメチレン エチレン 10 -0 - InC _{IB} H _J POLY E ドロキシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明 PLUS E ドロキシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明	۳	EPS-46	ヒドロキシエチルセルロース(ハーキュレス)	20万		2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	12	þ	-nC ₁₁ H ₂₅	0.00
SPS-S Eドロキシエチルセルロース(UCC) 80万 2.5 2-Eドロキシトリメチレン - 0 -0- -ICLBLA - Eドロキシエチルセルロース(UCC) 80万 1.8 -(CH ₂) ₃ CO- エチレン 50 -0- -ICLBLA - はれいしょでんぶん (片山化学) - - 2-Eドロキシエチレノメチレン エチレン 10 -0- -ICLBLA SURF67 Eドロキシエチルセルロース 不明	+	SPS-K1	ヒドロキシエチルセルロース (UCC)	150万	1.8	2-ヒドロキシトリメチレン	1	0	-0	-nC ₁₈ H ₃₇	0.0032
ー E F D キシエチルセルロース (UCC) 80万 1.8 - (CH ₂) ₃ CO- エチレン 50 -O- - IC ₁ H ₁ s - (対れいしょでんぶん (片山化学) - - - - - - IC ₁ H ₁ s POLY SURF67 E F D キシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 PLUS PLUS E F D キシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	+	SPS-S	トドロキシエチルセルロース(ハーキュレス)	150万	2.5	2-ヒドロキシトリメチレン	1	0	þ	-nC ₁₈ H ₃₇	0.0037
一 ばれいしょでんぶん (片山化学) 一 一 2-とドロキシトリメチレン エチレン 10 -0- 一の「山地 10 -0- 」 「山地 10 上間 1	+	,	ヒドロキシエチルセルロース (UCC)	80万	1.8	-(CH ₂), CO-	エチレン	20	수	-nC _g H ₁₇	0.010
POLY SURF67 とドロキシエチルセルロース PLUS 330CS 不明	╁╌	ı	ばれいしょでんぷん(片山化学)	ì	l	2-ヒドロキシトリメチレン	エチレン	2	φ	-nC ₁₁ H ₁₅	0.002
PLUS とドロキシエチルセルロース 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明 不明	-	POLY SURF67		大馬	不明	不明	不明	0	不明	不明	十週
		PLUS 330CS	ヒドロキシエチルセルロース	十二	不明	不明	大思	0	不明	不明	不明



[0049]

実施例1

(1) 本発明のセスキテルペンアルコールは、1%溶液となるよう、蒸留水で調製した。室内環境アレルゲンとして、ヒョウヒダニアレルゲンであるDerf2 量をマウスモノクローナル抗体によるサンドイッチELISA法により、アサヒビール社製のDerf2抗体、標識抗体を用いて測定した。

アレルゲン低減化効果は、蒸留水で同様の処理をしたときのDerf2量を1としてコントロールに対する比で表した。

[0050]

(2)トリイスクラッチエキス「ダニ」(鳥居製薬社製)を透析チューブに入れ、10%PBS溶液で一晩透析し(4%)、エキス中に含まれるグリセロールを除去した。本透析ダニエキスの濃度が、0.5 mg/mLとなるようにPBSで調製した。このダニエキス 50μ Lと蒸留水で調製した1%サンプル溶液 50μ Lを1.5 mLのシリコナイズトマイクロチューブに入れ、vortexで撹拌後、室温で2時間静置した。コントロールとして、サンプルの代わりに同量の蒸留水を用いた。ポジコンとして、同量の1%タンニン酸を用いた。次に、11.25%BSA(PBSに溶解) 400μ Lを各チューブに加えて反応を停止させ、15、000 rpm、室温で10%間遠心分離し、上清をELISAに供した。上記反応液中のDerf2量をアサヒビール社製抗Derf2モノクローナル抗体(15E11)、HRP標識抗Derf2モノクローナル抗体(15E11)、HRP標識抗Derf2を用いて、添付のプロトコールに従い測定した。

蒸留水を用いたときのDerf2量を1として各サンプルで処理したDerf2量の比を求めた。結果を表2に示す。

[0051]



【表2】

	試 料	Derf2量(コントロール比)
	化合物 9	0.6
	化合物1	0.6
	化合物 6	0.4
太	化合物10	0.6
発明品	化合物11	0.5
品	化合物12	0.6
	化合物13	0.6
	化合物21	0.8
	化合物22	0.8
比	タンニン酸	0. 2
較品	蒸留水	1. 0

[0052]

以上より本発明の化合物は、高いアレルゲン低減化効果を有していた。

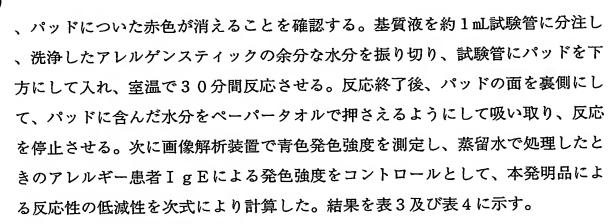
[0053]

実施例2

酵素標識抗 I g E抗体を用いて検出する試薬である抗原特異的 I g E抗体検出 試薬クイーデルアレルギースクリーン(Xenith Biomed社製)を用いて、ディッ プスティック上に固相されたアレルゲン(ハウスダスト、コナヒョウヒダニ、ヤ ケヒョウヒダニ、ネコ上皮、スギ、ブタクサなど)とアレルギー患者 I g E抗体 との反応性を以下のように測定した。

湿潤箱内に上記アレルゲンスティックをパッドが上になるように置き、パッド上に1%に調製した本発明品 100μ L/stickを含浸させ室温で2時間静置させる。洗瓶に入れた生理食塩水で各々のパッドを均一に30秒間洗浄したのち、アレルギー患者血清 50μ L/stickをパッド上に静かに滴下し均一に広げる。湿潤箱に蓋をして18時間室温で静置する。反応終了後、洗瓶に入れた生理食塩水で各々のパッドを均一に20秒間洗浄する。

酵素標識抗 I g E 抗体を約 1 mL試験管に分注し、洗浄したアレルゲンスティックの余分な水分を振り切り、試験管にパッドを下方にして入れ、室温で30分間反応させる。反応終了後、水道水で各々パッドを均一に2分間洗浄する。この時



アレルゲン低減化効果(%)=

100-(本発明品処理した際のIgE反応強度-陰性コントロールの反応強度)/(蒸留水処理したコントロールIgE反応強度-陰性コントロールの反応強度)×100

[0054]

【表3】

アレルゲン低減化効果(%)<動物アレルゲン>

	試 料	ハウスダスト1	コナヒョウダニ	ヤケヒョウダニ	ネコ上皮
	化合物1	8 6	8 0	9 0	8 7
	化合物 4	100	100	100	99
	化合物17	5 2	4 6	5 1	48
	化合物18	9 7	9 8	9 8	96
本	化合物14	9 9	98	9 7	98
本発明品	化合物 2	9 9	9 5	9 5	9 7
"温	化合物15	9 7	8 9	8 5	9 7
	化合物16	9 9	8 1	8 2	9 7
	化合物 3	100	9 7	9 6	100
	化合物21	9 2	8 7	8 6	98
	化合物22	6 2	6 2	6 0	7 7
IIL.	タンニン酸	8 3	6 2	7 0	9 2
比較品	スメクタイト	4 0	3 1	5 5	2 3
品	蒸留水	0	0	0	0

[0055]



【表4】

アレルゲン低減化効果(%) <植物アレルゲン>

	試 料	スギ	ブタクサ
本発	化合物1	7 0	9 9
本発明品	化合物4	9 0	100
LL	タンニン酸	7 8	Nd
比較品	スメクタイト	5 0	7 5
1111	蒸留水	0	0

[0056]

以上より本発明化合物は高いアレルゲン低減効果を有していた。

[0057]

【発明の効果】

本発明のアレルゲン低減化剤を用いれば、人体に悪影響が無く且つ着色等の問題を引き起こすことなく、環境中に存在するハウスダスト等のアレルゲンを低減化することができる。



【書類名】

要約書

【要約】

【解決手段】 セルロースエーテル又はスターチエーテルを主鎖とする多糖 誘導体であって、そのヒドロキシ基の水素原子の一部又は全てが、下記一般式(1):

$$-E^{1}-(OA)_{n}-E^{2}-R$$
 (1)

〔式中、 E^1 はヒドロキシ基又はオキソ基が置換していてもよい炭素数 $1\sim6$ のアルキレン基を示し、nは $0\sim5$ 0の数を示し、n個のAは同一又は異なって、炭素数 $1\sim6$ のアルキレン基を示し、 E^2 はエーテル結合又はオキシカルボニル基を示し、Rはヒドロキシ基が置換していてもよい炭素数 $4\sim3$ 0のアルキル基又はヒドロキシ基が置換していてもよい炭素数 $1\sim5$ のスルホアルキル基若しくはその塩を示す。〕

で表される基で置換された多糖誘導体からなるアレルゲン低減化剤。

【効果】 人体に悪影響が無く且つ着色等の問題を引き起こすことなく、環境中に存在するハウスダスト等のアレルゲンを低減化することができる。

【選択図】 なし





認定・付加情報

特許出願の番号

特願2002-194588

受付番号

5 0 2 0 0 9 7 4 9 4 2

書類名

特許願

担当官

第五担当上席

0094

作成日

平成14年 7月 4日

<認定情報・付加情報>

【提出日】

平成14年 7月 3日



特願2002-194588

出願人履歴情報

識別番号

[000000918]

1. 変更年月日

1990年 8月24日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

花王株式会社

氏 名

2003年 4月18日

2. 変更年月日 [変更理由]

名称変更

住所変更

住 所

東京都中央区日本橋茅場町1丁目14番10号

氏 名

花王株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

Ļ	■ BLACK BORDERS	
>	IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
(☐ FADED TEXT OR DRAWING	
(☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	•
. [☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
[☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
C	GRAY SCALE DOCUMENTS	
	LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
	REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	
(OTHER:	·

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.